

旋轉塗佈機及顯影機

P9000 Cluster 設備



P9000 Cluster

設備是一台高口能及多功能的晶圓處理設備，可配置有塗佈、顯影、HMDS 蒸鍍、熱板、冷板等模組，並廣泛使用於光阻及感光性聚合物等製程。其完善的軟體搭配最先進的硬體設備得以讓使用者可以同時使用不同溫度的烤盤 HMDS 蒸鍍、光阻塗佈及顯影等功能。

主要特點：

- 無需更換任何硬體即可處理 50 mm – 200 mm (2" ~ 8") 之基板。
- 強大的圖形使用者介面 (Graphic User Interface, GUI)
 - C&D 的圖形使用者介面 (GUI) 結合了 Rabbit 微處理器，提供強大的控制系統。此控制系統可以即時監控製程參數數據資料、事件報告及批次報
 - 此多功能的 C&D 控制系統可以同時讓二個不同的流程得以同時運行。此特點可以讓使用者充份運用所有製程模組之優勢以提高口能。
- 可以同時運行二組不同程序
 - P9000 有二個晶舟盒可以獨立編輯，這二個晶舟盒平台可以讓使用者彈性使用50片晶圓或是二個獨立的25片晶圓。同時在不改變設備的尺寸下可以新增不同的模組。
- 中央氣動式手臂採用雙端受動器
 - 中央氣動式手臂提供可靠的雙端受動器以提高口能及晶圓溫度敏感度
- 設備尺寸僅 5' x 5' (1.5m x 1.5m) 節省地面空間
 - P9000以模組堆疊方式使空間達到最大化，如熱板、冷板、真空烘烤及 HMDS 蒸鍍三大模組堆疊。同時， P9000 可在現有空間增加模組，以達企業成長及製程需求。
- 高效能馬達以提高膜厚均勻性及可靠性
- CE標誌認證，符合歐盟要求

